

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年9月24日(24.09.2020)



(10) 国際公開番号

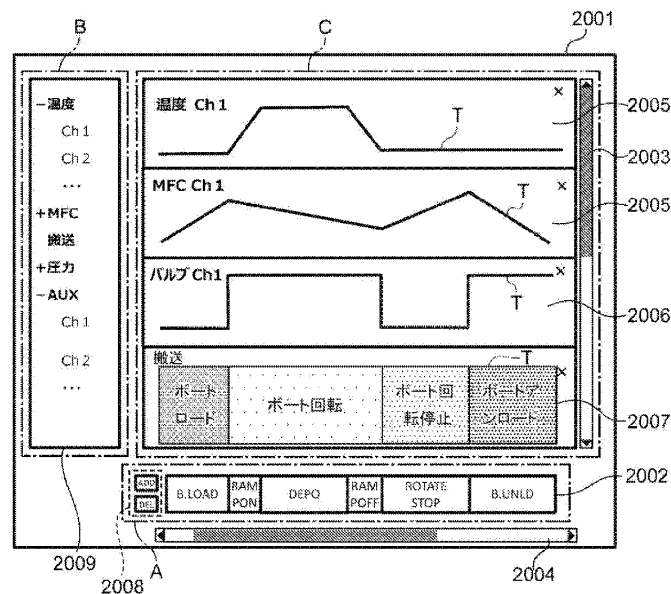
WO 2020/188820 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/02 (2006.01) H01L 21/31 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2019/011897
- (22) 国際出願日: 2019年3月20日(20.03.2019)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人: 株式会社 KOKUSAI ELECTRIC (KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION)
[JP/JP]; 〒1010045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 関 貴敏 (SEKI, Takatoshi); 〒9392393 富山県富山市八尾町保内二丁目1番
- (74) 代理人: 特許業務法人太陽国際特許事務所 (TAIYO, NAKAJIMA & KATO); 〒1600022 東京都新宿区新宿4丁目3番17号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,

(54) Title: RECIPE CREATION METHOD, MANUFACTURING METHOD OF SEMICONDUCTOR DEVICE USING CREATED RECIPE, SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS, AND RECIPE CREATION PROGRAM

(54) 発明の名称: レシピ作成方法、作成されたレシピを用いた半導体装置の製造方法、及び基板処理装置、並びにレシピ作成プログラム

[図6]



(57) Abstract: A recipe editing screen including a selection screen area for displaying a list of parameters to select a parameter included in a recipe of a substrate processing apparatus and a parameter editing screen area for editing the parameter is displayed on a display unit, and selection operation for selecting the parameter as an editing target from the

[続葉有]

QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告 (条約第21条(3))

list of parameters displayed on the selection screen area is received. A timing chart that is for editing the parameter selected by the selection operation as the editing target and is changed for each step of a series of steps included in a manufacturing process is editably displayed on the parameter editing screen area, an operation instruction to edit the timing chart is received, the display of the timing chart is changed in accordance with the operation instruction, and the parameter, the editing target, is edited.

(57) 要約: 基板処理装置のレシピに含まれるパラメータを選択するためのパラメータの一覧を表示する選択画面エリアと、パラメータを編集するためのパラメータ編集画面エリアとを備えたレシピ編集画面を表示部に表示させて、選択画面エリアに表示されたパラメータの一覧から、編集対象とするパラメータを選択する選択操作を受け付ける。選択操作によって選択された編集対象のパラメータを編集するためのタイミングチャートであって、製造工程に含まれる一連のステップの各ステップの時刻において変化するタイミングチャートをパラメータ編集画面エリアに編集可能に表示し、タイミングチャートを編集する操作指示を受け付けて、操作指示に応じてタイミングチャートの表示を変化させて、編集対象のパラメータを編集する。